

слабо отклоняться магн. полем и под действием электрич. поля будут ускоряться практически по прямой линии. Энергия, набираемая ионами в таком ускорителе, близка к разности потенциалов, приложенной между анодом и катодом, умноженной на заряд иона, а разрядный ток близок к току ускоренных ионов. В целом описываемый П. у. работает след. образом. Ускоряемый газ поступает через анод в кольцевой ускорительный канал УК (рис. 5). Здесь в облаке дрейфующих электронов нейтральные атомы ионизуются. Возникший при ионизации электрон за счёт столкновений и под влиянием колебаний диффундирует на анод, а ион, ускоренный электрич. полем E , покидает канал. После выхода из канала ион (чтобы не нарушилась квазинейтральность) получает электрон от катода-компенсатора КК. Существует ряд модификаций П. у. с замкнутым дрейфом (с анодным слоем, однолинзовыми, многолинзовыми и т. п.). Эти ускорители в стационаре позволяют получать плаズменные потоки с эф. током ионов от единиц до сотен А с энергией от 100 эВ до 10 кэВ и более. П. у. с анодным слоем представляют собой системы, в к-рых для ускорения ионов используются слои толщиной порядка электронного ларморовского радиуса, подобно тем, к-рые обеспечивают «магн. изолацию»

Существуют не только стационарные, но и импульсные П. у. с анодным слоем. Примером могут служить «магнитоизолированные диоды», с помощью которых получаются ионные токи до 1 МА с энергией 1 МэВ. Длительность импульса таких систем составляет обычно доли мкс.

Применение П. у. Первые П. у. (рельсотроны) появились в сер. 1950-х гг. С тех пор эти системы непрерывно изучаются и совершенствуются. Они нашли применение как плазменные двигатели (см. также Электро-ракетные двигатели), в технологии для чистки поверхностей (методом катодного распыления), нанесения металлич. плёнок на разл. поверхности, в исследованиях по ионосферной аэродинамике, в термоядерных исследованиях (в качестве инжекторов плазмы), плазмохимии, в лазерной технике, для активных экспериментов в космосе и т. д.

ПЛАЗМЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР — 1) генератор низкотемпературной плазмы, то же, что *плазмotron*. 2) П. г. С В Ч - изучение — источник эл.-магн. излучения, возникающего при взаимодействии релятивистического пучка электронов с плазмой. Подробнее см. в статье *Плазменная электроника*.

ПЛАЗМЕННЫЙ КАТОД (в общем случае — плазменный электрод) — область разряда вблизи собственно катода, в к-рой плазма создаётся при помощи спец. средств, не связанных с осн. разрядом. Способов образования П. к. существует несколько. К их числу можно отнести взрыв микроострий на катоде с образованием плазменного факела в вакуумном диоде [1], скользящий разряд вдоль поверхности диэлектрика [1, 2], дополнит. дуговой разряд с вдувом инертного газа для защиты электродов от коррозии в МГД-генераторах [3] и т. п. Осн. назначение П. к. — обеспечить управление плотностью тока на катоде независимо от величины тока осн. разряда.

величин тока осн. разряда.

Лит.: 1) Месяц Г. А., Генерирование мощных наносекундных импульсов, М., 1974; 2) Газовые лазеры, под ред. И. Мак-Даниеля и У. Нигана, пер. с англ., М., 1986; 3) Магнитогидродинамические генераторы открытого цикла, под ред. П.Х. Хейбмана и Г. Вумека, пер. с англ., М., 1972.

2. Ачиновский

ПЛАЗМЕННЫЙ ФОКУС — нестационарный густой плотной высокотемпературной дейтериевой плазмы, являющейся локализов. источником нейтронов и жёстких излучений; так же называют и электроразрядную установку, в к-рой получается эта плазма. П. ф. относится к разряду пинчей (см. *Пинч-эффект*); образуется

в области кумуляции токовой оболочки на оси газоразрядной камеры спец. конструкции, вследствие чего, в отличие от z-пинча, приобретает паццилиндрическую (обычно воронкообразную) форму. Благодаря этому удаётся резко повысить плотность энергии в плазме (эффект фокусировки) и стимулировать ряд процессов, приводящих к генерации мощных импульсов жёстких излучений [1]. В 90-е гг. термоядерный кпд П. ф. достигает 0,1% от энергии, запасённой в источнике питания (в пересчёте на дейтерий-тритиевую смесь), мощность нейтронного излучения $\sim 10^{21}$ н/с, жёсткого и мягкого рентг. излучения $\sim 10^{10}$ Дж/с и 10^{11} Дж/с соответственно. Малые размеры излучающей области (0,01—3 см), относит компактность и дешевизна конструкции делают этот источник одним из наиб. перспективных.

П. ф. был открыт Н. В. Филипповым в 1954 [2] в процессе изучения z -пинчей в плоской металлич. камере (рис. 1, слева), а затем аналогичные явления наблюдались Дж. Мейзером в 1961 [3] в коаксиальных плазменных инжекторах (рис. 1, справа). Как видно из рис., установка, с помощью к-рой наблюдается П. ф., состоит из источника импульсного питания 1 (обычно малоиндуктивная конденсаторная батарея), ключа 2 (обычно разрядник высокого давления) и разрядной камеры, корпус к-рой 3 является катодом; от него изолятором 4 отделён внутр. электрод 5 — анод. После откачки воздуха камера заполняется рабочим газом —

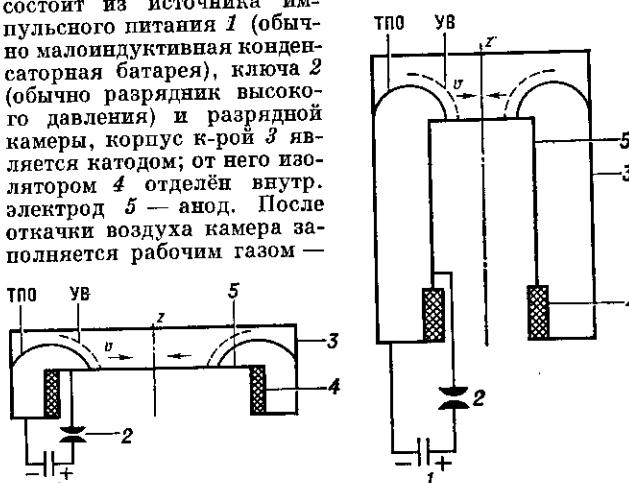


Рис. 1. Схема плазменного фокуса: слева — с плоскими электродами; справа — с цилиндрическими электродами. УВ — ударная волна; ТПО — токово-плазменная оболочка.

дайтерием, водородом, дайтерий-тритиевой смесью (часто с добавками благородных газов) при давлении 0,5—10 мм рт. ст. либо чистыми благородными газами при давлении 10^{-2} — 10^{-1} мм рт. ст. Далее через газ осуществляется разряд мощной конденсаторной батареи — проводится серия т. н. тренировочных пусков установки с целью очистки камеры от посторонних примесей (удаления воздуха из электродов и изолятора); насыщения анода рабочим газом для поддержания ионной составляющей тока; напыления металлич. плёнки на изолятор для повышения его электрич. прочности; напыления на анод металлич. плёнки вперемежку с атомами газа для облегчения электрич. взрыва на его поверхности при переходе в т. н. рентг. режим (см. ниже). Во время этих пусков выход жёстких излучений не наблюдается. С ростом числа пусков появляются жёсткие излучения и каждая установка проходит три стадии, сменяющие друг друга через неск. сотен пусков: 1) режим с одним сжатием; 2) режим с двумя сжатиями; 3) рентг. режим. Физ. процессы, происходящие в зоне П. ф., сложны и многообразны, наиб. характерны для него сграбление плазмы, образованной ударной волной, сжатие плазмы в центре анода, обрыв тока.

Режим с одним сжатием. В этом режиме после подачи напряжения на анод ($\sim 20-40$ кВ) происходит пробой рабочего газа по поверхности изолятора, на к-рой по-